

Title (en)

Process for the after-treatment of plates, foils or strips and its application as substrate for offset printing plates.

Title (de)

Verfahren zur Nachbehandlung von platten-, folien- oder bandförmigem Material, Träger aus derartigem Material und seine Verwendung für Offsetdruckplatten.

Title (fr)

Procédé de post-traitement de plaques, feuilles ou bandes et son application comme support pour plaques d'impression.

Publication

**EP 0683248 A1 19951122 (DE)**

Application

**EP 95107331 A 19950515**

Priority

DE 4417907 A 19940521

Abstract (en)

Plates which have been chemically, mechanically or electrochemically roughened are anodised and then treated in an aqueous solution of a pure and crystalline alkali metal silicate followed by rinsing in an ion-containing water.

Abstract (de)

Anoxidierte Al/AIOOH-Oberflächen von Aluminiumschichtträgern werden durch Antrag von Natriumschichtsilikat 9-Na<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in Abhängigkeit von der Konzentration der Antragslösung und der Temperatur des Tauchbades silikatisiert. Bei dem Natriumschichtsilikat handelt es sich um reines, kristallines Natriumsilikat. Es besitzt einen schichtförmigen, polymeren Aufbau. Zur Erhöhung der Alkaliresistenz von silikatisierten Aluminiumschichtträgern wird mit ionenhaltigem Wasser, beispielsweise Stadtwasser, oder mit Lösungen, die Alkali- und/oder Erdalkalitionen enthalten, nachgespült.

IPC 1-7

**C25D 11/24**; **C25D 11/18**; **B41N 1/08**

IPC 8 full level

**B41M 7/00** (2006.01); **B41N 1/08** (2006.01); **B41N 3/03** (2006.01); **C25D 11/18** (2006.01); **C25D 11/20** (2006.01); **C25D 11/24** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

**B41N 1/08** (2013.01 - EP US); **B41N 3/034** (2013.01 - KR); **B41N 3/038** (2013.01 - EP KR US); **C25D 11/18** (2013.01 - EP US); **C25D 11/20** (2013.01 - KR); **C25D 11/24** (2013.01 - EP KR US); **B41N 1/083** (2013.01 - KR)

Citation (applicant)

- EP 0105170 B1 19880113
- EP 0154201 B1 19870819

Citation (search report)

[XD] EP 0105170 A2 19840411 - HOECHST AG [DE]

Cited by

ITMO20130129A1; DE102007057777B4; DE102007057777A1; WO2011045423A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE DE FR GB IT NL

DOCDB simple family (publication)

**EP 0683248 A1 19951122**; **EP 0683248 B1 19971217**; AT E161297 T1 19980115; BR 9502487 A 19951219; DE 4417907 A1 19951123; DE 59501119 D1 19980129; JP H07316882 A 19951205; KR 950032719 A 19951222; US 5556531 A 19960917; US 5770315 A 19980623

DOCDB simple family (application)

**EP 95107331 A 19950515**; AT 95107331 T 19950515; BR 9502487 A 19950519; DE 4417907 A 19940521; DE 59501119 T 19950515; JP 12230595 A 19950522; KR 19950012654 A 19950520; US 43516295 A 19950505; US 61039296 A 19960304